

公害防止組織に関する法律 特定工場  
【水質1】

特定施設番号は水質汚濁防止法施行令第11に掲げる番号です。

特定施設番号		特定施設	
1	19	紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	イ まゆ湯煮施設 ロ 副帯処理施設 ハ 原料浸せき施設 ニ 精練機及び精練そう ホ シルケツト機 ヘ 漂白機及び漂白そう ト 染色施設 チ 薬液浸透施設 リ のり抜き施設
2	22	木材薬品処理業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	イ 湿式パーカー ロ 薬液浸透施設
3	23-2	新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	イ 自動式フィルム現像洗浄施設 ロ 自動式感光版付印刷版現像洗浄施設
4	24	化学肥料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	イ ろ過施設 ロ 分離施設 ハ 水洗式破砕施設 ニ 廃ガス洗浄施設 ホ 湿式集じん施設
5	26	無機顔料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	イ 洗浄施設 ロ ろ過施設 ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機 ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設 ホ 廃ガス洗浄施設
6	27	前号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	イ ろ過施設 ロ 遠心分離機 ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設 ニ 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設 ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設 ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設 ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設 チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設 リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設 ヌ 廃ガス洗浄施設 ル 湿式集じん施設
7	28	カーバ이트法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	イ 湿式アセチレンガス発生施設 ロ 酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施設 ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸留施設 ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設 ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設 ヘ クロロフレンモノマー洗浄施設
8	29	コールタール製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	イ ベンゼン類硫酸洗浄施設 ロ 静置分離器 ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設
9	31	メタン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸留施設 ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設 ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設
10	32	有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	イ ろ過施設 ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設 ハ 遠心分離機 ニ 廃ガス洗浄施設
11	33	合成樹脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	イ 縮合反応施設 ロ 水洗施設 ハ 遠心分離機 ニ 静置分離器 ホ 弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸留施設 ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸留施設 ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設 チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設 リ 廃ガス洗浄施設 ヌ 湿式集じん施設
12	34	合成ゴム製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	イ ろ過施設 ロ 脱水施設 ハ 水洗施設 ニ ラテックス濃縮施設 ホ ステレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器
13	35	有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	イ 蒸留施設 ロ 分離施設 ハ 廃ガス洗浄施設
14	37	前6号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第51号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	イ 洗浄施設 ロ 分離施設 ハ ろ過施設 ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設 ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はポリリンジアミンの製造施設のうち、蒸留施設 ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設 ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設

			チ エチレンオキシド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設 リ ニーエチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸留施設 ヌ シクロヘキサン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設 ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設 フ アルマルバラフィン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設 ワ プロピレンオキシド又はプロピレングリコールのけん化器 カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設 ヨ メチルメタクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設 タ 廃ガス洗浄施設	
15	38-2	界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)		
16	41	香料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	イ 洗浄施設 ロ 抽出施設	第41号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する抽出の用に供するものに限る。)
17	43	写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設		第43号に掲げる施設
18	46	第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	イ 水洗施設 ロ ろ過施設 ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設 ニ 廃ガス洗浄施設	第46号に掲げる施設(有害物質若しくはこれらを含む物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは1,4-ジオキサンを溶剤として使用する有機化学工業製品の製造の用に供するものに限る。)
19	47	医薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	イ 動物原料処理施設 ロ ろ過施設 ハ 分離施設 ニ 混合施設(第2条各号に掲げる物質を含む物を混合するものに限る。以下同じ。) ホ 廃ガス洗浄施設	第47号に掲げる施設(水銀若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物若しくは砒素若しくはその化合物若しくはこれらを含む物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは1,4-ジオキサンを溶剤として使用する医薬品の製造の用に供するものに限る。)
20	48	火薬製造業の用に供する洗浄施設		第48号に掲げる施設(ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する火薬の製造の用に供するものに限る。)
21	50	第2条各号に掲げる物質を含む試薬の製造業の用に供する試薬製造施設		第50号に掲げる施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は1,4-ジオキサンの試薬の製造の用に供するものに限る。)
22	51	石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	イ 脱塩施設 ロ 原油常圧蒸留施設 ハ 脱硫施設 ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設 ホ 潤滑油洗浄施設	第51号に掲げる施設(トリクロロエチレンを使用する潤滑油の洗浄の用に供するものに限る。)
23	53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	イ 研磨洗浄施設 ロ 廃ガス洗浄施設	第53号に掲げる施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、酸化鉛、ほう素若しくはその化合物若しくはふつ素化合物を原料として使用するガラス若しくはガラス製品の製造の用に供するもの又はトリクロロエチレン若しくは
24	58	窯業原料(うわ窯原料を含む。)の精製業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	イ 水洗式破砕施設 ロ 水洗式分別施設 ハ 酸処理施設 ニ 脱水施設 イ タール及びガス液分離施設	第58号に掲げる施設(ほう素化合物を原料として使用するうわ窯原料の精製の用に供するものに限る。)
25	61	鉄鋼業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	ロ ガス冷却洗浄施設 ハ 圧延施設 ニ 焼入れ施設 ホ 湿式集じん施設 イ 還元そう	第61号に掲げる施設(コークスの製造又は転炉ガスの冷却洗浄の用に供するものに限る。)
26	62	非鉄金属製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	ロ 電解施設(溶融塩電解施設を除く。) ハ 焼入れ施設 ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設 ヘ 湿式集じん施設	第62号に掲げる施設(銅、鉛若しくは亜鉛の第一次製錬若しくは鉛若しくは亜鉛の第二次製錬、水銀の精製又はふつ素化合物を原料として使用するウランの酸化物の製造の用に供するものに限る。)
27	63	金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	イ 焼入れ施設 ロ 電解式洗浄施設 ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設 ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設	第63号に掲げる施設(液体浸炭による焼入れ、シアン化合物若しくは六価クロム化合物を使用する電解式洗浄、カドミウム電極若しくは鉛電極の化成又は水銀の精製の用に供するものに限る。)
28	63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設	イ タール及びガス液分離施設	第63号の3に掲げる施設
29	64	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの	ロ ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)	第64号に掲げる施設(コークス炉ガス又はコークスの製造の用に供するものに限る。)
30	65	酸又はアルカリによる表面処理施設		第65号に掲げる施設(クロム酸、ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物による表面処理の用に供するものに限る。)
31	66	電気めつき施設		第66号に掲げる施設(カドミウム化合物、シアン化合物、六価クロム化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ほう素化合物、ふつ素化合物又はアンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を使用する電気めつきの用に供するものに限る。)
32	66-2	エチレンオキシド又は1,4-ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)		第66号の2に掲げる施設
33	71-5	トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)		第71号の5に掲げる施設
34	71-6	トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)		第71号の6に掲げる施設